

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第1区分

【発行日】平成24年8月23日(2012.8.23)

【公表番号】特表2011-527578(P2011-527578A)

【公表日】平成23年11月4日(2011.11.4)

【年通号数】公開・登録公報2011-044

【出願番号】特願2011-517568(P2011-517568)

【国際特許分類】

C 12 M 3/04 (2006.01)

【F I】

C 12 M 3/04 A

【手続補正書】

【提出日】平成24年7月6日(2012.7.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

気体透過性の培養装置において、

アクセスポートと、

側壁、上壁、および底壁と、

複数のスキヤホールドであって、1つのスキヤホールドが別のスキヤホールドの上方に置かれ、細胞コンパートメントを形成する空間によって各々分離されている、複数のスキヤホールドと、

細胞コンパートメントにアクセスポートを接続するマニホールドと、

1つ以上の気体コンパートメントであって、雰囲気気体に連通している開口部を有し、気体透過性の材料から構成された1つ以上の壁を有し、該1つ以上の壁はスキヤホールドではない、気体コンパートメントと、を備え、

気体コンパートメントの気体透過性の材料から構成された前記1つ以上の壁は、スキヤホールドに対しほぼ垂直に配向されている、装置。

【請求項2】

スキヤホールドはスキヤホールド開口部を有し、気体コンパートメントはスキヤホールド開口部を貫通している、請求項1に記載の装置。

【請求項3】

各細胞コンパートメントに前記気体透過性の材料の1つの壁が存在している、請求項1に記載の装置。

【請求項4】

側壁の少なくとも一部は気体透過性の材料から構成されている、請求項1に記載の装置。

【請求項5】

側壁は気体透過性の材料から構成されていない、請求項1に記載の装置。

【請求項6】

気体コンパートメントへの開口部が1つ存在し、底面、上面、または側面上に配置されている、請求項1に記載の装置。

【請求項7】

気体コンパートメントへの開口部は2つの対向する壁上に配置されており、気体コンパ

ートメントは気体透過性の前記装置全体を通じる開口部である、請求項1に記載の装置。

【請求項8】

気体コンパートメントへの開口部の形状はほぼ矩形である、請求項1に記載の装置。

【請求項9】

スキヤホールドはポリスチレン材料を含む、請求項1に記載の装置。

【請求項10】

気体コンパートメントの前記1つ以上の壁の気体透過性の材料はシリコーンである、請求項1に記載の装置。

【請求項11】

前記シリコーンの厚みは0.56ミリメートル(約0.022インチ)以下である、請求項10に記載の装置。

【請求項12】

2つのアクセスポートが前記装置の対向する端部上に配置されている、請求項1に記載の装置。

【請求項13】

気体コンパートメント開口部は矩形であり、気体コンパートメントへの開口部の最も長い側面は、近傍にアクセスポートが存在する対向する端部に対し、ほぼ垂直である、請求項12に記載の装置。

【請求項14】

気体コンパートメント支持構造を含む、請求項1に記載の装置。

【請求項15】

最も上のスキヤホールドの上方の空間は、他のスキヤホールド間のいずれの空間よりも大きい、請求項1に記載の装置。

【請求項16】

間隙がスキヤホールドと壁、スキヤホールドに隣接している気体コンパートメントの側壁、前記1つの壁またはその両方との間に存在している、請求項1に記載の装置。

【請求項17】

気体コンパートメントへの開口部の幅は2.54ミリメートル(0.1インチ)以上である、請求項1に記載の装置。

【請求項18】

いずれかのスキヤホールドの上面上の最も遠い位置から気体透過性の材料までの距離は、他のすべてのスキヤホールドの上面上の最も遠い位置から気体透過性の材料までの距離を超えない、請求項1に記載の装置。